

中华人民共和国国家标准

GB 11072—89

锑化铟多晶、单晶及切割片

Indium antimonide polycrystal, single
crystals and as-cut slices

1989-03-31发布

1990-02-01实施

国家技术监督局发布

中华人民共和国国家标准

锑化铟多晶、单晶及切割片

GB 11072—89

Indium antimonide polycrystal, single
crystals and as-cut slices

1 主题内容与适用范围

本标准规定了锑化铟多晶、单晶及单晶切割片的产品分类、技术要求和试验方法等。

本标准适用于区熔法制备的锑化铟多晶及直拉法制备的供制作红外探测器和磁敏元件等用的锑化铟单晶及其切割片。

2 引用标准

GB 4326 非本征半导体单晶霍尔迁移率和霍尔系数测量方法

GB 8759 化合物半导体单晶晶向 X 射线衍射测量方法

3 产品分类

3.1 导电类型、规格

3.1.1 多晶

多晶的导电类型为 N 型,按载流子迁移率分为三级。

3.1.2 单晶

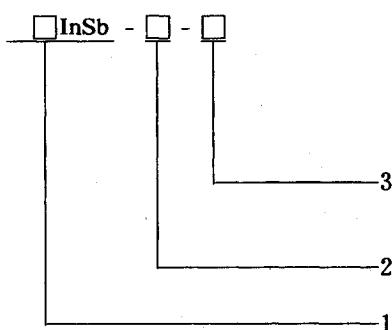
锑化铟单晶按导电类型分为 N 型和 P 型,以掺杂剂、载流子浓度和迁移率分类,按直径与位错密度分为三级。

3.1.3 切割片

按3.1.2分类与分级,其厚度不小于500 μm。

3.2 牌号

3.2.1 锑化铟多晶与单晶的牌号表示为:



1——用 PInSb 表示锑化铟多晶, MInSb 表示锑化铟单晶;